MEMS研究開発拠点 装置一覧　　2025年4月1日現在

No.	装置番号	施設等名称	備考		
			試料寸法	設置場所	用途
1	MEMS001	ウェハディップ洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
2	MEMS002	ウェハスピン洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
3	MEMS003	有機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
4	MEMS004	異方性ウェットエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
5	MEMS005	IPA ベーパー乾燥機	200mm	TKB812-F	処理
6	MEMS006	i-線ステッパ	200mm	TKB812-F	加工
7	MEMS007	マスク露光装置	200mm	TKB812-F	加工
8	MEMS008	マスクレス露光装置	500mm 角以下	TKB812-F	加工
9	MEMS010	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-F	分析・評価
10	MEMS011	Si 酸化膜プラズマCVD 装置	200mm/300mm	TKB812-F	加工
11	MEMS012	スパッタ	200mm	TKB812-B	加工
12	MEMS013	酸化炉	200mm	TKB812-F	加工
13	MEMS015	Si 窒化膜減圧CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
14	MEMS016	ポリ Si 減圧 CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
15	MEMS017	金属膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
16	MEMS018	Si 酸化膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
17	MEMS019	8″Si 深掘ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
18	MEMS020	12″Si 深掘ドライエッチング装置	300mm	TKB812-F	加工
19	MEMS021	犠牲層ドライエッチング装置	100/150/200mm	TKB812-F	加工
20	MEMS022	アッシャー	300 mm以下	TKB812-F	加工
21	MEMS023	光学検査顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
22	MEMS024	段差測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
23	MEMS025	エリプソメーター	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
24	MEMS026	膜厚測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
25	MEMS027	ウェハ塵埃検査装置	200 mm	TKB812-F	分析・評価
26	MEMS028	干渉型表面形状評価装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
27	MEMS029	シート抵抗プローバー	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
28	MEMS030	赤外線レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
29	MEMS031	レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
30	MEMS032	ブレードダイサー	300mm 以下	2A-CR	加工
31	MEMS033	レーザステルスダイサー	200mm 以下	2A-CR	加工
32	MEMS034	光学顕微鏡	300mm 以下	2A-CR	分析・評価
33	MEMS035	大面積ナノインプリント装置	200mm 角以下	2A-CR	加工
34	MEMS036	電子ビーム/抵抗蒸着装置	200 mm	TKB812-B	加工
35	MEMS037	熱処理装置	200mm	TKB812-B	加工
36	MEMS038	チップ to ウェハ接合装置	100/150/200/300mm	TKB812-B	加工
37	MEMS039	ウェハ to ウェハ接合装置	100/150/200mm	TKB812-B	加工
38	MEMS040	パリレンコータ	100mm	2G-CR	加工
39	MEMS041	光表面処理装置	200mm	TKB812-B	処理
40	MEMS042	12″ウェハ常温接合装置	100/150/200/300mm	3F-CR	加工
41	MEMS043	測長 SEM	200mm	TKB812-B	分析・評価
42	MEMS044	分析 SEM	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価

43	MEMS045	超音波顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
44	MEMS046	赤外線顕微鏡	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
45	MEMS047	薄膜応力評価装置	100/125/150/200 mm	TKB812-B	分析・評価
46	MEMS048	X 線 CT 評価装置	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価
47	MEMS049	テスタープローバー	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
48	MEMS050	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
49	MEMS051	圧電定数評価装置	100-200mm	3H-CR	分析・評価
50	MEMS053	ダイシェアテスタ	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価
51	MEMS055	レジストスプレーコータ	200mm 角以下	2G-CR	加工
52	MEMS056	反応性イオンエッチング装置	200mm	2G-CR	加工
53	MEMS058	無機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
54	MEMS059	レジスト塗布現像装置	200 mm	TKB812-F	分析・評価
55	MEMS060	イオンミリング装置	200mm 以下	TKB812-B	加工
56	MEMS061	電界放射型 SEM	100mm 以下	2A 実験室	分析・評価
57	MEMS062	4″Si 深掘ドライエッチング装置	100mm 以下	2G-CR	加工
58	MEMS063	4″スパッタ装置	100mm 以下	2G-CR	加工
59	MEMS066	4″フォトリソグラフィ設備	100mm 以下	2G-CR	加工
60	MEMS067	レーザ描画装置	100mm 以下	2G-CR	加工
61	MEMS069	自動光学顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
62	MEMS070	レーザードップラー測定器	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
63	MEMS071	フーリエ変換赤外分光装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
64	MEMS072	小口径スパッタ	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価
65	MEMS073	マニュアルプローバ	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
66	MEMS074	ダイシングフィルム貼付装置	200mm 以下	2A-CR	加工
67	MEMS075	保護フィルム貼付装置	200mm 以下	TKB812-F	加工
68	MEMS076	フォトリソ工程用オーブン	200mm 以下	TKB812-F	加工
69	MEMS077	2流体洗浄装置	200mm 以下	3F-CR	処理